# Тиристор Silicon Controlled RectifierSCR

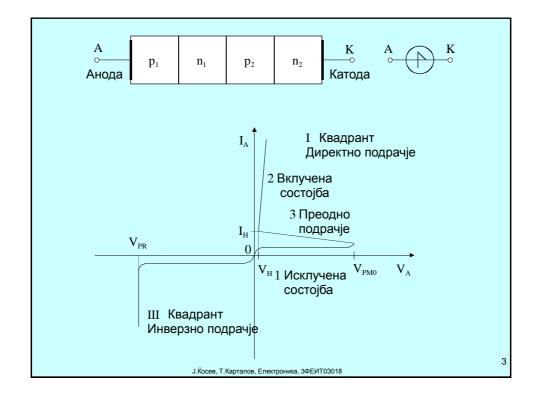
J. Косев. Т. Карталов. Електроника. 3ФЕИТ03018

### Поделба и особини

- Тиристорот е четирислоен **pnpn** елемент
- Примена: насочувач и прекинувач.
- За струи > 1000А,
- Напон на пробивање > 2kV.
- Еднонасочен диоден тиристор (динистор):

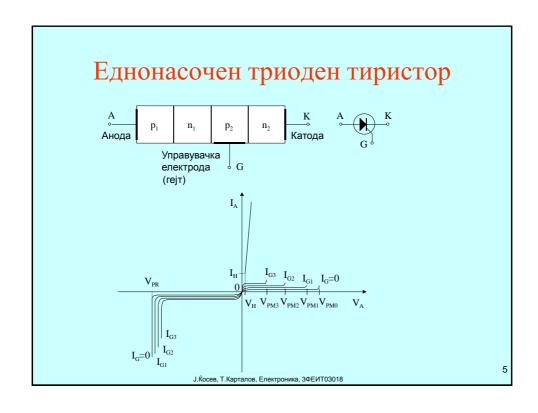
2

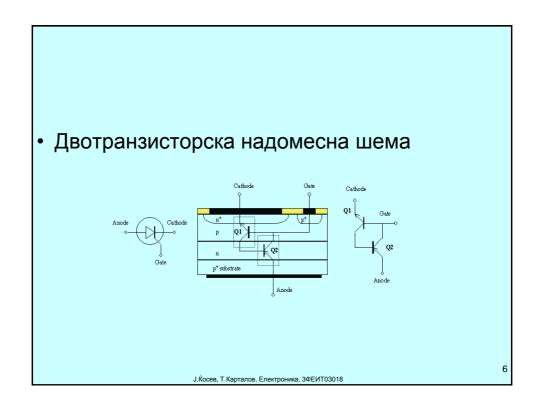
. Г. Косев Т. Карталов Електроника ЗФЕИТОЗОТ

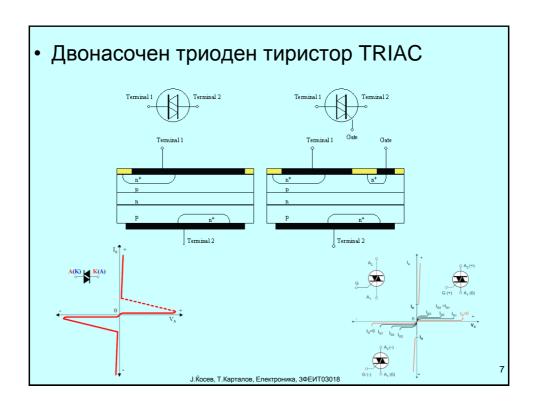


- V<sub>РМО</sub> напон на прелом 20V 2kV.
- V<sub>PR</sub> напон на пробив |V<sub>PR</sub>| > V<sub>PM0</sub>
   (V<sub>BR</sub>) break

. 1 Косев Т Карталов Електроника ЗФЕИТОЗО18

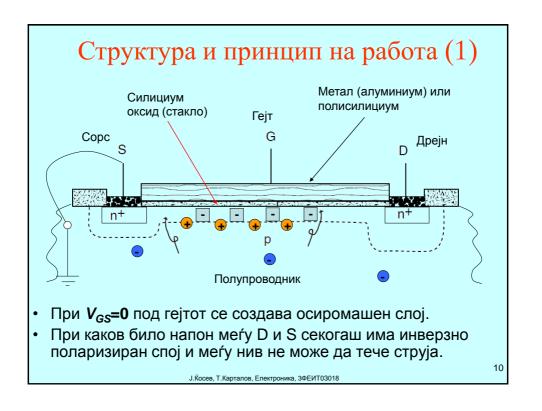


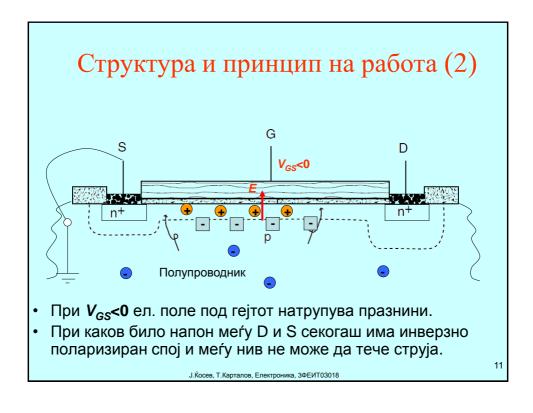


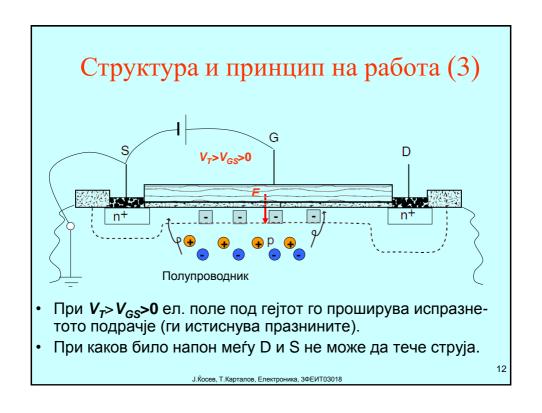


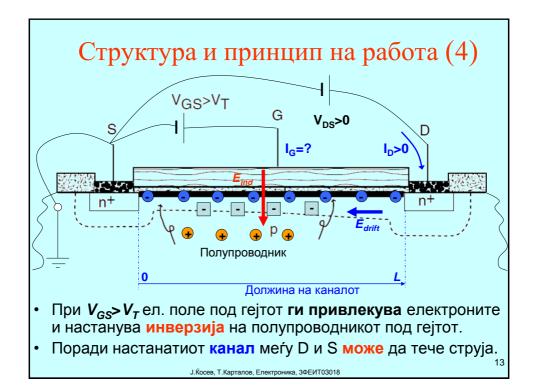
# Мосфет Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor MOSFET











### • Анимација:

http://www.youtube.com/watch?v=QO5FgM7MLGg

J.Ќосев, Т.Карталов, Електроника, 3ФЕИТ0301

1

## Структура и принцип на работа (5)

- Гејтот и инвертираниот канал сочинуваат кондензатор. Проводноста во каналот зависи од привлечените електрони.
- $\sigma \sim n \sim Q \sim E_{ind}(x) \sim (V_{GS}-V_K(x)-V_T)$ ;  $V_K(x)$  е потенцијалот во каналот
- Струјата зависи од "хоризонталното" поле.
- $I_D \sim \sigma \cdot K_{drift}(x) \sim \sigma \cdot dV_K(x)/dx \Rightarrow I_D \sim (V_{GS} V_K(x) V_T) \cdot dV_K(x)/dx$

$$I_D dx = const \cdot (V_{GS} - V_T - V_K(x)) dV_K(x)$$

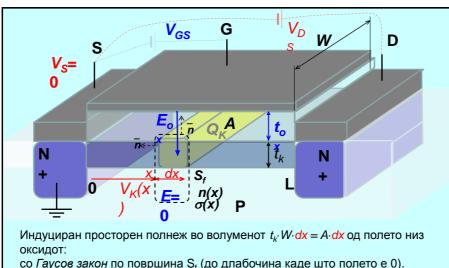
• Интеграција на x од 0 до L во каналот и  $V_K$  од 0 до  $V_{DS} \Rightarrow$ 

$$I_{D} = \beta (V_{GS} - V_{T})V_{DS} - \frac{\beta}{2}V_{DS}^{2}$$

$$\beta = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}}\mu_{n}\frac{W}{L}$$

$$\beta = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}} \mu_n \frac{W}{L}$$

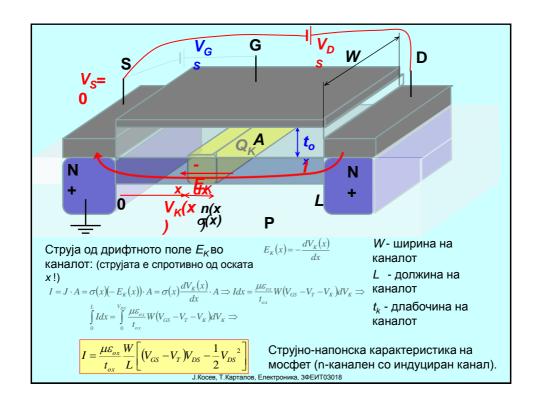
J. Ќосев, Т. Карталов, Електроника, 3ФЕИТ03018

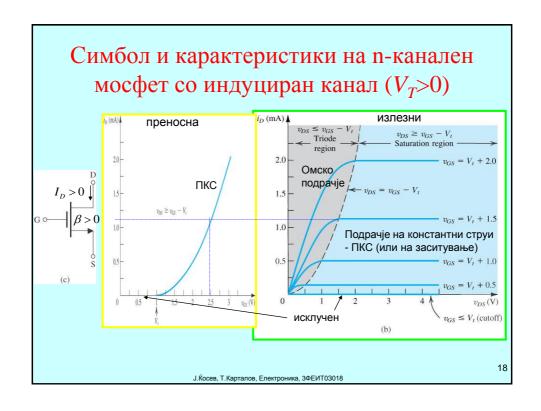


со *Гаусов закон* по површина 
$$\mathbf{S_f}$$
 (до длабочина каде што полето е 0). 
$$E_{ox} = -\frac{((V_{OS} - V_T) - V_K(x))}{t_{ox}} \qquad Q_K = \oint_{\mathcal{S}_f} DdS = -\varepsilon_{ox} E_{ox} W dx = -\varepsilon_{ox} \frac{((V_{OS} - V_T) - V_K(x)) W dx}{t_{ox}} \qquad Q_K = -qn(x) \cdot Adx$$

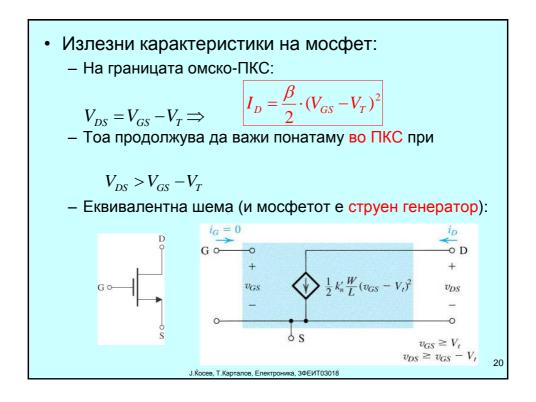
$$\Rightarrow n(x) = \varepsilon_{ox} \frac{(V_{GS} - V_T - V_K(x))W}{qAt_{ox}} \Rightarrow \sigma(x) = q\mu_n n(x) = \frac{\mu_n \varepsilon_{ox}}{t_{ox}} \frac{W}{A} (V_{GS} - V_T - V_K(x))$$

Специфична проводност во волуменот Adx





#### • Излезни карактеристики (друг поглед): $I_{D}(\mu A)$ Омско Подрачје на $V_T = 2V$ заситување подрачје 400 $V_{DDS} = V_{GS} - V_{T}$ $V_{GS} = 6V$ 300 200 $V_{GS} = 5V$ 100 5 2 3 4 J. Ќосев, Т. Карталов, Електроника, 3ФЕИТ03018

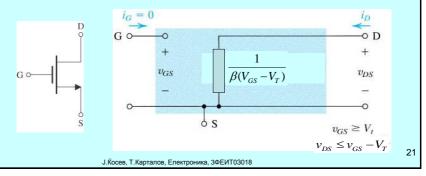


- Излезни карактеристики на мосфет:
  - Длабоко во омското подрачје мосфетот е напонски управуван отпорник:

$$V_{DS} \ll V_{DS} \Rightarrow I_D = \beta (V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{\beta}{2} \cdot V_{DS}^2 \approx \beta (V_{GS} - V_T) V_{DS} \Rightarrow$$

$$R_{DS} = \frac{V_{DS}}{I_D} = \frac{1}{\beta (V_{GS} - V_T)}$$

- Еквивалентна шема:





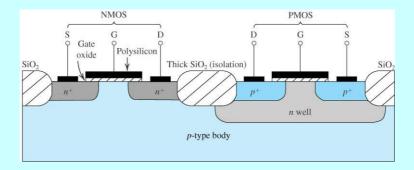
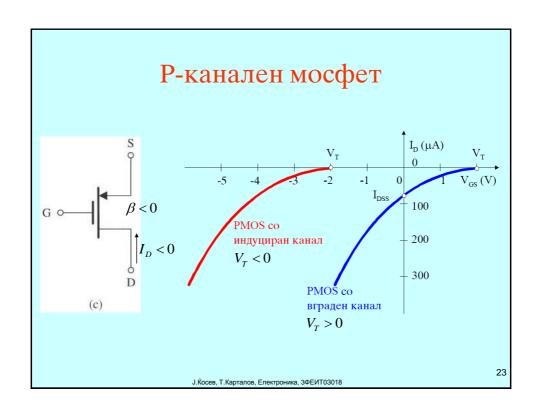
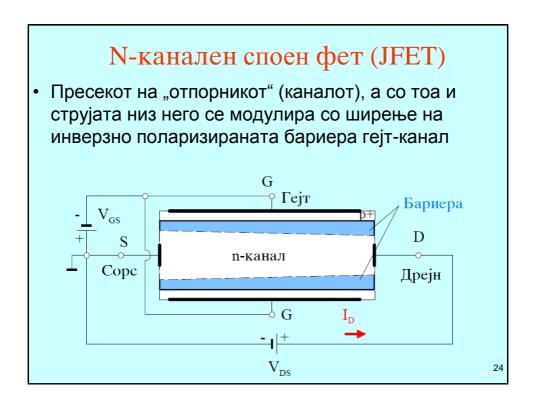


Figure 4.9 Cross-section of a CMOS integrated circuit. Note that the PMOS transistor is formed in a separate n-type region, known as an n well. Another arrangement is also possible in which an n-type body is used and the n device is formed in a p well. Not shown are the connections made to the p-type body and to the n well; the latter functions as the body terminal for the p-channel device.

J.Ќосев, Т.Карталов, Електроника, 3ФЕИТ0301

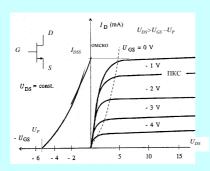
22





## Параметри на споен n-фет (JFET)

- Напон на допир  $V_{GS} = V_P < 0$  напон при кој каналот е целосно затворен,
- Струја на потполно отворен канал  $I_{DSS}$ ,
- I-U карактеристики:



Во ПКС приближно важи:

$$I_D \approx I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

J.Косев, Т.Карталов, Електроника, 3ФЕИТ03018

25